(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Biiro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 11. August 2005 (11.08.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/073427 A2

(51) Internationale Patentkiassifikation7: C23C 14/06. 14/35, B05D 7/24

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/013258

(22) Internationales Anmeldedatum:

23. November 2004 (23.11.2004)

(25) Einrelchungsspruche: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 005 313.8 2. Februar 2004 (02.02,2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V. [DE/DE]; Hansastrasse 27 c. 80686 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): CHARTON, Christoph [DE/DE]; Zum Heiderand 26, 01328 Dresden (DE). FAHLAND, Matthias [DE/DE]; Berthold-Haupt-Strasse 111, 01259 Dresden (DE). KRUG, Mario [DE/DE]; Bruno-Dietze-Ring 44, 01844 Neustadt/Sachsen (DE). SCHILLER, Nicolas [DE/DE]; Fabrikstrasse 5, 01833 Stolpen, OT Helmsdorf (DE). PCT-Gazette verwiesen.

STRAACH, Steffen [DE/DE]; Hohe Strasse 83, 01187 Dresden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG. PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der

(54) Title: METHOD FOR THE PRODUCTION OF AN ULTRA BARRIER LAYER SYSTEM

(54) Bezelchnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ULTRABARRIERE-SCHICHTSYSTEMS

(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of an ultra barrier layer system by vacuum coating a substrate, said layer system comprises a stack of layers which are embodied as an alternating layer system made of smooth layers and transparent ceramic layers, comprising a smooth layer arranged between two transparent ceramic layers, which are applied by sputtering, whereby a monomer is introduced into an evacuated covering chamber during the deposition of the smooth layer, wherein a magnetron plasma is operated.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Ultrabarriere-Schichtsystems durch Vakuumbeschichtung eines Substrates mit einem Schichtstapel, der als Wechselschichtsystem aus Glättungsschichten und transparenten keramischen Schichten ausgebildet wird, mindestens jedoch eine Glättungsschicht zwischen zwei transparenten keramischen Schichten umfasst, welche durch Sputtern aufgebracht werden, bei dem während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Monomer in eine evakuierte Beschichtungskammer eingelassen wird, in der ein Magnetronplasma betrieben wird.

5

15

30

35

WO 2005/073427

PCT/EP2004/013258

Verfahren zur Herstellung eines Ultrabarriere-Schichtsystems

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines transparenten Ultrabarriere-Schichtsystems durch Vakuumbeschichtung.

Barriereschichten dienen der Diffusionshemmung. Sie vermindern die Permeation durch ein beschichtetes Substrat. Häufige Anwendungen finden sich dort, wo verhindert werden soll, dass bestimmte Substanzen, z. B. Lebensmittel als Verpackungsgut, mit Sauerstoff aus der Umgebung in Kontakt kommen oder Wasser mit der Umgebung austauschen können. Dabei steht in erster Linie eine oxidative Umsetzung oder Verderblichkeit der zu schützenden Substanzen im Brennpunkt des Interesses. Daneben kommt unter anderem auch der Schutz verschiedenster oxidationsgefährdeter Substanzen in Betracht, wenn diese in Schichtverbunde integriert sind. Besondere Bedeutung kommt dem Schutz dieser Substanzen zu, wenn die Verzögerung der oxidativen Umsetzung die Lebensdauer von Produkten bestimmt.

Barriereschichten setzen verschiedenen diffundierenden Substanzen teilweise einen sehr unterschiedlichen Widerstand entgegen. Zur Charakterisierung von Barriereschichten wird häufig die Permeation von Sauerstoff (OTR) und Wasserdampf (WVTR) unter definierten Bedingungen durch die mit der Barriereschicht versehenen Substrate herangezogen. Barriereschichten haben außerdem oft die Aufgabe einer elektrischen Isolationsschicht. Ein wichtiges Einsatzgebiet von Barriereschichten stellen Display-Anwendungen dar.

Durch Beschichtung mit einer Barriereschicht wird die Permeation durch ein beschichtetes Substrat um einen Faktor verringert, der im einstelligen Bereich liegen oder viele Größenordnungen betragen kann. Unter Ultrabarriere-Schichten werden im Sinne der Erfindung Schichten verstanden, deren Barrierewirkung verhindert, dass Permeationswerte von WVTR = 0,05 g/m²d und OTR = 0,2 cm²/m²d überschritten werden (WVTR gemäß DIN 53122-2-A; OTR gemäß DIN 53380-3).

Häufig werden außer vorgegebenen Barrierewerten verschiedene andere Zielparameter von einer fertigen Barriereschicht erwartet. Beispielhaft stehen hierfür optische, mechanische sowie technologisch-ökonomische Anforderungen. Barriereschichten sollen oftmals unsichtbar sein, müssen also im sichtbaren Spektralbereich nahezu vollständig transparent sein, Werden Barriereschichten in Schichtsystemen eingesetzt, ist es häufig vorteilhaft,

WO 2005/073427

PCT/EP2004/013258

2

wenn Beschichtungsschritte zum Aufbringen einzelner Teile des Schichtsystems miteinander kombinierbar sind.

Einen wichtigen Platz unter den Beschichtungsverfahren, die bei der Herstellung von Schichtsystemen zum Einsatz kommen, nehmen Kathodenzerstäubungsverfahren, sogenannte Sputterverfahren, ein, da diese die Abscheidung von Schichten hoher Qualität ermöglichen. Bei der Herstellung von Schichtsystemen ist es daher oft wünschenswert, Sputterverfahren zumindest in Kombination mit anderen Beschichtungsverfahren einsetzen zu können.

10

30

Zur Herstellung von Barriereschichten werden häufig sogenannte PECVD-Verfahren (plasma enhanced chemical vapor deposition) eingesetzt. Diese kommen auf verschiedensten Substraten für unterschiedliche Schichtmaterialien zum Einsatz. Es ist beispielsweise bekannt, auf 13 µm PET-Substraten SiO₂- und Si₃N₂-Schichten einer Dicke von 20 bis 30 nm abzuscheiden (A. S. da SiNa Sobrinho et al., J. Vac. Sci. Technol. A 16(6), Now/Dec 1998, p. 3190-3198). Bei einem Arbeitsdruck von 10 Pa lassen sich auf diese Weise Permeationswerte von WVTR = 0,3 qm²d und OTR = 0,5 cm²/m²d erreichen.

Bei der Beschichtung mit SiO₄ für transparente Barriereschichten auf PET Substrat mittels PECVD lässt sich eine Sauerstoffbarriere von OTR = 0,7 cm³/m³d realisieren [R. J. Nelson and H. Chatham, Society of Vacuum Coaters, 34th Annual Technical Conference Proceedings (1991) p. 113-117]. Auch andere Quellen zu dieser Technologie gehen für transparente Barriereschichten auf PET-Substrat von Permeationswerten in der Größenordnung WVTR = 0,3 g/m²d und OTR = 0,5 cm³/m²d aus [M. Izu, B. Dotter, S. R. Ovshinsky, Society of Vacuum Coaters, 36th Annual Technical Conference Proceedings (1993) p. 333-340].

Nachteile der bekannten PECVD-Verfahren bestehen vor allem im Erreichen relativ geringer Barrierewirkungen. Das macht die Produkte insbesondere für Displayanwendungen uninteressant. Ein weiterer Nachteil besteht in dem hohen Arbeitsdruck, der für eine Durchführung des Verfahrens erforderlich ist. Soll ein derartiger Beschichtungsschritt in komplexe Produktionsabläufe in Vakuumanlagen integriert werden, wird unter Umständen ein hoher Aufwand für Maßnahmen der Druckentkopplung erforderlich. Insbesondere eine Kombination mit Sputterprozessen wird aus diesem Grunde zumeist unwirtschaftlich.

V/O 2005/073427 Page 4 of 16

3

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

Es ist bekannt, Barriereschichten durch Sputtern aufzubringen. Gesputterte Einzelschichten zeigen oft bessere Barriereeigenschaften als PECVD-Schichten. Für gesputtertes AINO auf PET werden als Permeationswerte beispielsweise WVTR = 0,2 g/m²d und OTR = 1 cm²/m²d angegeben [Thin Solid Films 388 (2001) 78-86]. Daneben sind zahlreiche andere Materialien bekannt, die insbesondere durch reaktives Sputtern zur Herstellung von transparenten Barriereschichten verwendet werden. Die so hergestellten Schichten weisen jedoch für Displayanwendungen ebenfalls zu geringe Barrierewirkungen auf. Ein weiterer Nachteil derartiger Schichten liegt in ihrer geringen mechanischen Belastbarkeit. Schädigungen, die durch technologisch unvermeidbare Beanspruchungen während der Weiterverarbeitung oder der Benutzung auftreten, führen meist zu einer deutlichen Verschlechterung der Barrierewirkung. Das macht gesputterte Einzelschichten für Barrierenwendungen häufig

unbrauchbar.

Es ist bekannt, Einzelschichten als Barriereschichten aufzudampfen. Durch dieses PVD-Verfahren können ebenfalls verschiedene Materialien direkt oder reaktiv auf verschiedensten Substraten abgeschieden werden. Für Barriereanwendungen ist beispielsweise die reaktive Bedampfung von PET-Substraten mit Al₂O₃ bekannt [Surface and Coatings Technology 125 (2000) 354-360]. Hierhei werden Permeationswerte von WVTR = 1 g/m²d und OTR = 5 cm²/m²d erreicht. Diese Werte sind ebenfalls viel zu hoch, um derart beschichtete Materialien als Barriere-20 schichten in Displays zu verwenden. Sie sind häufig mechanisch noch weniger belastbar als gesputterte Einzelschichten. Außerdem ist eine direkte Verdampfung meist mit einer hohen Verdampfungsgeschwindigkeit oder -rate verbunden. Das bedingt bei der Herstellung von in Barriereanwendungen üblichen dünnen Schichten entsprechend hohe Substratgeschwindigkeiten, um eine zu starke Beaufschlagung des Substrates zu vermeiden. Eine 25 Kombination mit Prozessschritten, die eine wesentlich geringere Durchlaufgeschwindigkeit erfordern, ist somit in Durchlaufanlagen nahezu unmöglich. Das betrifft insbesondere die Kombination mit Sputterprozessen.

30 Es ist bekannt, dass sich die mechanische Beständigkeit anorganischer Aufdampfschichten verbessern lässt, wenn während der Verdampfung eine organische Modifizierung vorgenommen wird. Dabei erfolgt der Einbau organischer Bestandteile in die sich während des Schichtwachstums ausbildende anorganische Matrix. Offenbar kommt es durch den Einbau dieser weiteren Bestandteile in die anorganische Matrix zu einer Erhöhung der Elastizität der gesamten Schicht, was die Gefahr von Brüchen in der Schicht deutlich reduziert. Stell-

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

vertretend als zumindest für Barriereanwendungen geeignet sei in diesem Zusammenhang ein Kombinationsprozess genannt, der eine Elektronenstrahlverdampfung von SiO, mit dem Einlass von HMDSO kombiniert (DE 195 48 160 C1). Für Displayanwendungen erforderliche niedrige Permeationsraten lassen sich mit derart hergestellten Schichten allerdings nicht

erzielen. Nachteilig ist außerdem, dass die Elektronenstrahlverdampfung die bereits angesprochenen hohen Beschichtungsraten bedingt, was eine Kombination mit vielen anderen Prozessschritten deutlich erschwert.

Es ist bekannt, Barriereschichten in mehreren Beschichtungsschritten aufzubringen. Ein

10 Verfahren bildet der sogenannte PML-Prozess (Polymer multilayer) (1999 Materials Research Society, p. 247-254); [J. D. Affinito, M. E. Gross, C. A. Coronado, G. L. Graff, E. N. Greenwell and P.M. Martin, Society of Vacuum Coaters, 39th Annual Technical Conference Proceedings (1996) p. 392-397]. Beim PML Prozess wird mittels Verdampfer ein flüssiger Acrylat-Film auf das Substrat aufgebracht, der mittels Elektronenstrahltechnik oder UV-15 Bestrahlung ausgehärtet wird. Dieser weist für sich keine besonders hohe Barrierewirkung auf. Anschließend erfolgt eine Beschichtung des ausgehärteten Acrylatfilms mit einer oxidischen Zwischenschicht, auf die wiederum ein Acrylatfilm aufgebracht wird. Diese Vorgehensweise wird bei Bedarf mehrfach wiederholt. Die Permeationswerte eines derart erzeugten Schichtstapels, also einer Kombination einzelner Acrylatschichten mit oxidischen Zwischenschichten, liegt unterhalb der Messgrenze von konventionellen Permeationsmessegeräten.

Vakuumanlagen müssen zwingend nach dem Mehrkammerprinzip arbeiten, was mit einem hohen Preis verbunden ist. Außerdem bildet sich zunächst ein flüssiger Film auf dem Substrat, der ausgehärtet werden muss. Das führt zu einer verstärkten Anlagenverschmutzung, was Wartungszyklen verkürzt. Der Prozess ist ebenfalls für hohe Bandgeschwindigkeiten optimiert und daher in-line schlecht zu kombinieren mit langsameren Beschichtungsprozessen, insbesondere einem Sputterprozess.

Nachteile bestehen vor allem im notwendigen Einsatz aufwendiger Anlagentechnik.

30 Es ist weiterhin bekannt, bei der Abscheidung von Diffusionssperrschichten, also Barriereschichten, Magnetronplasmen für eine Plasmapolymerisation einzusetzen (EP 0 815 283 B1); [S. Fujimaki, H. Kashiwase, Y. Kokaku, Vacuum 59 (2000) p. 657-664]. Hierbei handelt es sich um PECVD-Prozesse, die direkt durch das Plasma einer Magnetronentladung aufrechterhalten werden. Beispielhaft steht hierfür die Verwendung eines 35 Magnetronplasmas für PECVD-Beschichtung zur Abscheidung von Schichten mit einem

WO 2005/073427

35

PCT/EP2004/013258

5

Kohlenstoffgerüst, wobei als Precursor CH₂ dient. Derartige Schichten weisen jedoch ebenfalls eine für Displayanwendungen ungenügende Barrierewirkung auf.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde ein Verfahren zur Herstellung eines transparenten Barriereschichtsystems anzugeben, dessen Barrierewirkung ausreichend hoch ist, um die Schicht in Displayanwendungen einzusetzen, wobei das Verfahren sowohl von der Beschichtungsgeschwindigkeit als auch von den Vakuumanforderungen mit dem Magnetronsputtern kompatibel, also anlagentechnisch einfach kombinierbar sein soll.

10 Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein Verfahren entsprechend Anspruch 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens finden sich in den Ansprüchen 2 bis 27.

Die Erfindung nutzt die Eigenschaften keramischer Barriereschichten aus. Diese zeigen über einen weiten Dickenbereich hinweg eine Abhängigkeit der Barrierewirkung von der Schichtdicke. Versuche haben gezeigt, dass bei gleicher Gesamtdicke eine dicke Einzelschicht manchmal eine deutlich geringere Barrierewirkung zeigt als mehrere dünne Teilschichten, die durch andere, weitgehend barriereneutrale Zwischenschichten voneinander getrennt sind. Der umgekehrte Fall wurde nicht beobachtet. Es wurde weiter festgestellt, dass eine dünnere Einzelschicht zwar eine geringere Barrierewirkung zeigt als eine dickere, dass die dünnere Schicht aber bei mechanischer Beanspruchung ihre Barrierewirkung erst bei viel stärkerer Beanspruchung bzw. Deformation verliert als die dickere Schicht.

Die Barrierewirkung keramischer Schichten wird im Wesentlichen durch die Defektdichte und die Haftung der Schicht auf dem Substrat oder benachbarten Schichten bestimmt. Die teilweise hervorragende Barrierewirkung von Schichtstapeln, die mehrere dünne keramische Schichten enthalten, beruht offenbar darauf, dass Defekte in den einzelnen Schichten gegeneinander versetzt auftreten. Wo das nicht der Fall ist, erhöht sich bei gleicher Gesamtdicke der keramischen Beschichtung die Barrierewirkung eines Schichtstapels nur unwesentlich gegenüber der Barrierewirkung einer keramischen Einzelschicht.

Das erfindungsgemäße Verfahren basiert auf der abwechselnden Abscheidung von rein keramischen Schichten durch Magnetronsputtern und solchen Schichten, die mittels einem metall-organischen Precursor, der in einem Magnetronplasma umgesetzt wird, abgeschieden werden WO 2005/073427

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

6

Das Verfahren für die Schichtabscheidung mittels metall-organischem Precursor basiert auf der Zersetzung einer dampfförmigen metall-organischen Verbindung in einem Magnetronplasma, verbunden mit der Abscheidung einer organisch modifizierten Metallverbindung. Dabei hat das Metall seinen Ursprung in der metall-organischen Verbindung, während

5 weitere Schichtkomponenten sowohl aus der metall-organischen Verbindung stammen als auch zusätzlich in Gasform eingelassen werden k\u00f6nnen.

Die rein keramischen Schichten werden durch Magnetronsputtern aufgebracht. Dies kann in einem reaktiven oder nichtreaktiven Prozess deschehen.

10

20

25

Es hat sich gezeigt, dass durch die Schichtabscheidung mittels metall-organischem Precursor Zwischenschichten entstehen, die eine besonders effektive Steigerung der Barrierewirkung der keramischen Schichten bewirken. Offenbar weisen sie eine Struktur auf, die verhindert, dass sich das Wachstum von Defekten in den keramischen Schichten über mehrere Schichten hinweg fortsetzen kann. Dadurch können sich zwar in jeder einzelnen keramischen Schicht neue Defekte bilden, die in manchen Fällen durch die gesamte Dicke der Einzelschicht reichen können. Das Defektwachstum endet jedoch an der Zwischenschicht. Offenbar bildet sich durch die Art und Weise der Abscheidung der Zwischenschichten, die ein PECVD-Verfahren darstellt, in den Zwischenschichten eine Struktur heraus, die von der Struktur des Untergrundes nahezu unabhängig ist. Bis an eine Zwischenschicht heranreichende Defekte einer keramischen Schicht führen nicht zu Strukturveränderungen in der Zwischenschicht, die sich durch die gesamte Dicke der Zwischenschicht fortsetzen. Defekte einer im Schichtstapel befindlichen keramischen Schicht können somit nicht das Defektwachstum in einer anderen keramischen Schicht initiieren. Die Zwischenschichten führen zu einer Glättung defektbehafteter Oberflächen, weshalb sie im Folgenden im Sinne der Erfindung auch als Glättungsschichten bezeichnet werden. Durch den statistisch bedingten Versatz der Defekte in den einzelnen Schichten werden Permeationswege zwischen

30 Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass sich durch das Aufbringen der keramischen Schichten durch Sputtern eine ausgezeichnete Haftung zwischen den einzelnen Schichten des entstehenden Schichtstapels erzielen lässt. Das führt zu einer weiteren Verbesserung der Barrierewirkung. Es lassen sich bereits durch ein Schichtsystem, das aus zwei transparenten Keramikschichten und einer Glättungsschicht

Defekten zweier keramischer Schichten erheblich verlängert.

35 besteht, Permeationswerte von WVTR = 0,05 g/m²d und OTR = 0,2 cm³/m²d erreichen. Die

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

Barrierewirkung lässt sich durch Variation der Anzahl der Einzelschichten auf einfache Weise an vorgegebene Mindestanforderungen anpassen. Es lassen sich sogar Permeationsraten erzielen, die unterhalb der Messgrenze konventioneller Permeationsmessgeräte liegen.

7

5

20

25

Es handelt sich bei der Erfindung um ein Verfahren zur Herstellung eines Ultrabarriere-Schichtsystems durch Vakuumbeschichtung eines Substrates mit einem Schichtstapel, der als Wechselschichtsystem aus Glättungsschichten und transparenten keramischen Schichten ausgebildet wird, mindestens iedoch eine Glättungsschicht zwischen zwei transparenten keramischen Schichten umfasst, welche durch Sputtern aufgebracht werden, wobei während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Monomer in eine evakuierte Beschichtungskammer eingelassen wird, in der ein Magnetronplasma betrieben wird. Die Abscheidung beider Schichttypen des Wechselschichtsystems erfolgt also im Wesentlichen ieweils unter der Einwirkung eines Magnetronplasmas. Dadurch sind beide Beschichtungs-15 schritte sehr einfach in einer Vakuumanlage kombinierbar, da die Anforderungen an das Vakuum eine aufwendige Druckentkopplung überflüssig machen. Besonders stabil lässt sich das Verfahren betreiben, wenn sowohl für die Abscheidung der keramischen Schicht als auch zur Abscheidung der Glättungsschicht eine Magnetronanordung aus einem oder mehreren Magnetrons in Verbindung mit einer gepulsten Energieeinspeisung (1 kHz bis 300 kHz) verwendet wird. Dies verhindert zum einen die verstärkte Ausbildung von Bogenentladungen, und zum anderen bei der Verwendung von zwei oder mehr Targets und bipolarer Energieeinspeisung die übermäßige Bedeckung der Targets mit Reaktionsprodukten aus dem Beschichtungsprozess. Besonders effektiv arbeiten auf diese Weise Doppelmagnetrons, von denen jeweils eines als Kathode und eines als Anode fungiert und deren Polarität wechselt.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn zur Aufrechterhaltung des Magnetronplasmas während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Magnetron verwendet wird, das mit einem Target bestückt ist, das aus einem Material besteht, das mit Stickstoff oder Sauerstoff reaktiv umgesetzt werden kann. Dadurch kann ein derartiges Magnetron durch Wechsel des eingelassenen Gases einerseits unter Einlass von Reaktivgas zur Abscheidung transparenter keramischer Schichten und andererseits zur Unterstützung der Plasmapolymerisation bei Monomereinlass verwendet werden. In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens erfolgt die Abscheidung des Wechselschichtsystems durch wechselweisen Einlass von HMDSO und Sauerstoff.

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

8

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Aufrechterhaltung des Magnetronplasmas unabhängig vom Einlass der umzusetzenden Gase erfolgt. Das erreicht man durch zusätzlichen Einlass eines Arbeitsgases, vorzugsweise eines Edelgases. Besonders vorteilhaft lässt sich hierfür Argon verwenden. Als einzulassende Monomere haben sich erfindungsgemäß Kohlenwasserstoffe, Silane, Si-Organika oder Metallorganika bewährt. Als besonders vorteilhaft hat sich der Einsatz von HMDSO erwiesen, insbesondere, wenn als transparente keramische Schichten Oxide abgeschieden werden.

Besonders gute Resultate ergeben sich, wenn während der Abscheidung der Glättungsschicht zusätzlich zum Einlass von Monomeren Sauerstoff, Stickstoff und/oder Wasserstoff als Reaktivgas einlessen wird. Während der Abscheidung der Glättungsschicht wird vorteilhafterweise ein Prozessdruck von 0.1 Pa bis 10 Pa eingestellt, was diesen Beschichtungsschritt problemlos mit Zerstäubungsprozessen kombinierbar macht. Deshalb ist es besonders vorteilhaft, wenn die Abscheidung der transparenten keramischen Schichten durch Magnetronsputtern, vorzugsweise reaktives Magnetronsputtern, erfolgt, wobei als Reaktivaas Stickstoff, Sauerstoff und/oder Wasserstoff eingelassen wird.

Besonders vorteilhaft ist es, als transparente keramische Schicht SiO_2 , Al_2O_3 oder SiN abzuscheiden.

20

Die Beschichtung kann auf stationären oder bewegten bandförmigen Substraten vorgenommen werden, was das Verfahren vielseitig verwendbar macht. Besonders geeignet ist es zur Beschichtung von Kunststoffsbubstraten, insbesondere, wenn die Substrattemperatur auf weniger als 200 °C gehalten wird, was z. B. über die Einstellung einer entsprechenden Plasmaleistung problemlos möglich ist. Es lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Verfahren bei noch niedrigerer Einstellung der Substrattemperatur auch extrem temperaturempfindliche Substrate schädigungsfrei beschichten.

Besonders wirkungsvolle Barrieresysteme lassen sich erzielen, wenn die Beschichtungsraten und/oder die Substratgeschwindigkeit so eingestellt werden, dass Plasmapolymerschichten als Glättungsschichten mit einer Schichtdicke von 50 nm bis 5 µm und transparente keramische Schichten mit einer Schichtdicke von 5 nm bis 500 nm abgeschieden werden.

Durch die gute Kombinierbarkeit der einzelnen Beschichtungsschritte ist es möglich, alle
35 Einzelschichten unter der Wirkung des Plasmas einer einzigen Magnetronanordnung

WO 2005/073427 Page 10 of 16

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

9

abzuscheiden. Das ermöglicht den Einsatz sehr kompakter Anlagen. Vorteilhaft ist hierbei, wenn während der Abscheidung des Wechselschichtsystems die eingelassenen Flüsse von Monomer und Reaktivgas und/oder Arbeitsgas allmählich verändert werden und zumindest zeitweise gleichzeitig erfolgen, so dass einzelne Schichten des Wechselschichtsystems gradientenförmig ineinander übergehen. Eine besonders einfache Ausführungsform ergibt sich, wenn Reaktivgas und Monomer über einen gemeinsamen Gaseinlass eingelassen werden.

Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich auch mit Vorteil ausführen, wenn das Wechselschichtsystem mittels mindestens einer Magnetronanordnung abgeschieden wird und der Einlass von Monomer und Reaktivgas und/oder Arbeitsgas an unterschiedlichen Orten erfolgt, so dass sich bei Durchlaufen des Beschichtungsbereiches auf einem bewegten Substrat nacheinander die Schichten des Wechselschichtsystems abscheiden. Besonders vorteilhaft kann es dabei sein, wenn das Wechselschichtsystem mittels mindestens einer Magnetronanordnung abgeschieden wird und der Einlass von Monomer und Reaktivgas und/oder Arbeitsgas an unterschiedlichen Orten erfolgt, so dass sich im Bereich des Magnetronplasmas ein deutlicher Partialdruckgradient zwischen den eingelassenen Gasen ausbildet derart, dass sich bei Durchlaufen des Beschichtungsbereiches auf einem bewegten Substrat nacheinander Schichten abscheiden, die gradientenförmig ineinander übergehen. Dabei kann der Beschichtungsbereich mehrfach durchlaufen werden, um die Anzahl der Einzelschichten zu erhöhen. Auch für Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens mit gleichzeitigem Einlass von Monomer und Reaktivgas ist die Kombination von HMDSO und Sauerstoff von Vorteil. Dabei kann es zweckmäßig sein den Einlass von Reaktivgas und Arbeitsgas über einen gemeinsamen Gaseinlass vorzunehmen.

An drei Ausführungsbeispielen wird das erfindungsgemäße Verfahren näher erläutert.

25

35

In einem ersten Ausführungsbeispiel wird in einer Vakuumbeschichtungsanlage in einer Beschichtungsstation ein stationär angeordnetes Kunststoffsubstrat beschichtet. Dazu wird eine metall-organische Verbindung (HMDSO) in flüssiger Form einem Vorratsbehälter untergebracht und über einen Flowcontroller einem Verdampfer zugeführt, wo die Flüssigkeit verdampft wird. Über eine beheizte Zuleitung und einen ebenfalls beheizten weiteren Flowcontroller wird der Dampf in den zuvor evakuierten und mit Ar bis zu einem Druck zwischen 0.1 Pa und 10 Pa gefüllten Prozessraum eingelassen. Zusätzlich können andere Reaktivasse wie Sauerstoff oder Stickstoff eingelassen werden. Alle Gase werden bevorzugt

V/O 2005/073427 Page 11 of 16

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

in der unmittelbaren Nähe eines im Prozessraum gezündeten Magnetronplasmas eingelassen. Das Plasma wird von einer Doppelmagnetronanordnung erzeugt, die bipolar gepulst betrieben wird, wobei die Pulsfrequenz zwischen 1 kHz und 100 kHz liegt. Die Targets der Magnetrons bestehen aus Aluminium.

10

- 5 Begonnen wird mit dem Einlass von Sauerstoff. Die Aluminiumtargets werden somit in einem Gemisch aus Argon und Sauerstoff zerstäubt, wodurch eine transparente keramische Schicht (Al₂O₂) in einem reaktiven Sputterprozess aufgebracht wird. Bei Erreichen einer Sollschichtdicke wird die Sputterrate reduziert und der Sauerstoffeinlass beendet. Anschließend erfolgt der Einlass von HMDSO, wodurch unter der Einwirkung des Magnetron-plasmas eine Glättungsschicht abgeschieden wird. Ist deren Sollschichtdicke erreicht, wird der Einlass von HMDSO beendet und mit der reaktiven Aufstäubung einer Aluminiumoxidschicht fortgefahren. Dieser Zyklus wird bei Bedarf mehrfach durchlaufen, bis sich eine geforderte Barrierewirkung erwarten lässt. Diese kann durch anschließende Messungen überrüft werden.
- Bei einer derartigen stationären Beschichtung kann durch Wahl eines geeigneten Targetmaterials wie Si, Ti oder Al das Aufbringen eines Wechselschichtsystems in analoger Weise durch einfachen Wechsel der eingelassenen Gase zwischen metall-organischem Dampf und O₂ oder N₂ erfolgen.
- Der Vorteil dieser Variante ist, dass nur eine einzige Beschichtungsstation nötig ist, da das

 Magnetronplasma einmal zur Schichtabscheidung der keramischen Schicht und einmal zur

 Umsetzung des metall-organischen Precursors verwendet wird.

In einem zweiten Ausführungsbeispiel wird in einer Vakuumbeschichtungsanlage, die mit einem Abwickel und einem Aufwickel für bandförmige Substrate ausgerüstet ist, in 25 mindestens einer Beschichtungsstation ein kontinuierlich bewegtes Kunststoffsubstrat beschichtet. Dazu wird eine metall-organische Verbindung (HMDSO) in flüssiger Form in einem Vorratsbehälter untergebracht und über einen Flowcontroller einem Verdampfer zugeführt, wo die Flüssigkeit verdampft wird. Über eine beheizte Zuleitung und einen ebenfalls beheizten weiteren Flowcontroller wird der Dampf in den zuvor evakuierten und 30 mit Ar bis zu einem Druck zwischen 0.1 Pa und 10 Pa gefüllten Prozessraum eingelassen. Zusätzlich können andere Reaktivgase wie Sauerstoff oder Stickstoff eingelassen werden. Alle Gase werden bevorzugt in der unmittelbaren Nähe eines im Prozessraum gezündeten Magnetronplasmas eingelassen. Das Plasma wird von einer Doppelmagnetronanordnung erzeugt, die bipolar gepulst betrieben wird, wobei die Pulsfreguenz zwischen 1 kHz und 100 kHz liegt. Die Targets der Magnetrons bestehen aus Aluminium. 35

WO 2005/073427

15

WO 2005/073427

PCT/EP2004/013258

11

Die Vakuumbeschichtungsanlage wird mit nur einer Beschichtungsstation betrieben. Es wird zunächst mit dem Einlass von Sauerstoff begonnen. Die Aluminiumtargets werden in einem Gemisch aus Argon und Sauerstoff zerstäubt, wodurch eine transparente keramische Schicht (Al₂O₃) in einem reaktiven Sputterprozess aufgebracht wird. Die Schichtdicke der transparenten keramischen Schicht kann über die Vorschubgeschwindigkeit des bandförmigen Substrates und über die dem Sputterprozess zugeführte elektrische Leistung eingestellt werden. Ist die gewünschte Länge des bandförmigen Substrates beschichtet, wird der Beschichtungsprozess unterbrochen und die Bandlaufrichtung umgekehrt. Danach erfolgt der Einlass von HMDSO, wodurch unter Einwirkung des Magnetronplasmas eine Glättungsschicht bei umgekehrter Bandlaufrichtung abgeschieden wird. Dieser Zyklus wird bei Bedarf mehrfach mit wechselnder Bandlaufrichtung durchlaufen, bis sich eine geforderte Barrierewirkung erwarten lässt. Diese kann durch anschließende Messungen überprüft werden. Auf diese Weise lassen sich in einer einzigen Beschichtungsstation Schichtstapel aus beliebig vielen Einzelschichten auf langgestreckten Substraten herstellen In einem dritten Ausführungsbeispiel wird in einer Vakuumbeschichtungsanlage, die mit einem Abwickel und einem Aufwickel für bandförmige Substrate ausgerüstet ist, in mehre-

In einem dritten Ausführungsbespiel wird in einer Vakuumbeschichtungsanläge, die mit einem Abwickel und einem Aufwickel für bandförmige Substrate ausgerüstet ist, in mehreren Beschichtungsstationen ein kontinuierlich bewegtes Kunststoffsubstrat beschichtet.

Dabei wird das Substrat nacheinander an benachbarten Beschichtungsstationen vorbei geführt, die entsprechend den vorangegangenen Beispielen entweder für einen reaktiven Sputterprozess zur Abscheidung von Al₂O₃ oder für eine plasmagestützte Abscheidung einer erfindungsgemäßen Glättungsschicht unter Einlass von HMDSO eingerichtet sind. Entspricht die Zahl der Beschichtungsstationen der Zahl der gewünschten Einzelschichten im herzustellenden Barriereschichtsystem, kann dieses in einem einzigen Durchlauf durch die Beschichtungsanlage aufgebracht werden. Daraus resultiert eine besonders hohe Effektivität derartiger Anlagen.

In allen drei Ausführungsbeispielen wird durch den Betrieb der Magnetrons mit einer gepulsten Energieeinspeisung zum einen die verstärkte Ausbildung von Bogenentladungen verhindert, zum anderen wird durch Verwendung von zwei Targets und bipolarer Energieeinspeisung die übermäßige Bedeckung der Targets mit Reaktionsprodukten aus dem Beschichtungsprozess verringert, was für eine stabile Prozessführung sorgt.

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

12

Patentansprüche

15

20

- Verfahren zur Herstellung eines Ultrabarriere-Schichtsystems durch Vakuumbeschichtung eines Substrates mit einem Schichtstapel, der als Wechselschichtsystem aus Glättungsschichten und transparenten keramischen Schichten ausgebildet wird, mindestens jedoch eine Glättungsschicht zwischen zwei transparenten keramischen Schichten umfasst, welche durch Sputtern aufgebracht werden, dadurch gekennzeichnet, dass während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Monomer in eine evakuierte Beschichtungskammer eingelassen wird, in der ein Magnetronplasma betrieben wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Magnetronplasma während der Abscheidung der Glättungsschicht gepulst mit einer Pulsfrequenz von 1 kHz bis 300 kHz betrieben wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufrechterhaltung des Magnetronplasmas während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Magnetron verwendet wird, das mit einem Target bestückt ist, das aus einem Material besteht, das mit Stickstoff oder Sauerstoff reaktiv umgesetzt werden kann.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Aufrechterhaltung des Plasmas während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Doppelmagnetron verwendet wird.
- Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass als Arbeitsgas ein Edelgas verwendet wird.
- Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Monomer Kohlenwasserstoffe, Silane, Si-Organika oder Metallorganika eingelassen werden.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass während der Abscheidung der Glättungsschicht zusätzlich zum Einlass von

15

30

13

Monomeren Sauerstoff, Stickstoff und/oder Wasserstoff als Reaktivgas eingelassen wird

- Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
 dass während der Abscheidung der Glättungsschicht ein Prozessdruck von 0.1 Pa bis
 10 Pa eingestellt wird.
- 9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
 dass die Abscheidung der transparenten keramischen Schichten durch Magnetronsputtern erfolgt.
 - Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheidung der transparenten keramischen Schichten durch reaktives Magnetronsputtern erfolgt, wobei als Reaktivgas Stickstoff, Sauerstoff und/oder Wasserstoff eingelassen wird.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass als transparente keramische Schicht Al₂O₃ abgeschieden wird.
- Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekenn zeichnet, dass als transparente keramische Schicht SiO₂ abgeschieden wird.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass als transparente keramische Schicht SIN abgeschieden wird.
- 25 14. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung auf stationären Substraten vorgenommen wird.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung auf bewegten bandförmigen Substraten vorgenommen wird.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass während der Beschichtung die Substrattemperatur unter 200 °C gehalten wird.

WO 2005/073427 PCT/EP2004/013258

14

- Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung auf Kunststoffsubstraten vorgenommen wird.
- 18. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtungsraten und/oder die Substratgeschwindigkeit so eingestellt werden, dass Plasmapolymerschichten als Glättungsschichten mit einer Schichtdicke von 50 nm bis 5 µm und transparente keramische Schichten mit einer Schichtdicke von 5 nm bis 500 nm abgeschieden werden.
- 19. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Wechselschichtsystem mittels einer Magnetronanordnung abgeschieden wird, in deren Plasma wechselweise ein Monomer und ein Reaktivgas eingelassen wird.
- Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheidung des Wechselschichtsystems durch wechselweisen Einlass von HMDSO und Sauerstoff vorgenommen wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass während der 20 Abscheidung des Wechselschichtsystems die eingelassenen Flüsse von Monomer und Reaktivgas und/oder Arbeitsgas allmählich verändert werden und zumindest zeltweise gleichzeitig erfolgen, so dass einzelne Schichten des Wechselschichtsystems gradientenförmig ineinander übergehen.
- Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass Reaktivgas und Monomer über einen gemeinsamen Gaseinlass eingelassen werden.
- 23. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekenn-30 zeichnet, dass das Wechselschichtsystem mittels mindestens einer Magnetronanordnung abgeschieden wird und der Einlass von Monomer und Reaktivgas und/oder Arbeitsgas an unterschiedlichen Orten erfolgt, so dass sich bei Durchlaufen des Beschichtungsbereiches auf einem bewegten Substrat nacheinander die Schichten des Wechselschichtsystems abscheiden.

WO 2005/073427

5

PCT/EP2004/013258

15

- 24. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Wechselschichtsystem mittels mindestens einer Magnetronanordnung abgeschieden wird und der Einlass von Monomer und Reaktivgas und/oder Arbeitsgas an unterschiedlichen Orten erfolgt, so dass sich im Bereich des Magnetronplasmas ein deutlicher Partialdruckgradient zwischen den eingelassenen Gasen ausbildet derart, dass sich bei Durchlaufen des Beschichtungsbereiches auf einem bewegten Substrat nacheinander Schichten abscheiden, die gradientenförmig ineinander übergehen.
- Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass ein bewegtes
 Substrat mehrmals durch den Beschichtungsbereich geführt wird.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Abscheidung des Wechselschichtsystems durch gleichzeitigen Einlass von HMDSO und Sauerstoff vorgenommen wird.
 - Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 23 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass Reaktivgas und Arbeitsgas über einen gemeinsamen Gaseinlass eingelassen werden.

15

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES		t PCT/ISA/220 sowie, soweit			
	03F43485-FEP	VORGEHEN		nachstehender Punkt 5			
	Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatur (Tag/Monat/Jahr)	n	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
	PCT/EP2004/013258	23/11/200	4	02/02/2004			
	Anmelder			1			
	FRAUNHOFER-GESELLSCAHFT ZUR	FÖRDERUNG DER					
	Dieser internationale Recherchenbericht wu Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem I			erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
	Dieser internationale Recherchenbericht um	nfaßt insoesamt 4	Blätter.				
9	_	•	Bericht genannter	Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
	Grundlage des Berichts Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing						
				hörde eingereichten Übersetzung der			
	internationalen Ann	neldung (Regel 23.1 b)) durchge	eführt worden.	norde eingereichten Obersetzung der			
	b. Hinsichtlich der in der intern	ationalen Anmeldung offenbart	en Nucleotid- u	nd/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.			
	2. Bestimmte Ansprüche hal	ben sich als nicht recherchie	bar erwiesen (si	iehe Feld II).			
	Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld III).					
	Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung						
	X wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.						
	wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:					
)							
	Hinsichtlich der Zusammenfassung						
	_	gereichte Wortfaut genehmigt.					
	Der Anmelder kann der Beh Recherchenberichts eine St	norde innerhalb eines Monats n	angegebenen Fa ach dem Datum o	issung von der Behörde festgesetzt. der Absendung dieses internationalen			
	6. Hinsichtlich der Zeichnungen						
	 a. ist folgende Abbildung der Zeichnu 	ngen mit der Zusammenfassur	g zu veröffentlich	nen: Abb. Nr			
	wie vom Anmelder	vorgeschlagen					
		e ausgewählt, weil der Anmeld					
		le ausgewählt, weil diese Abbild		g besser kennzeichnet.			
	b. wird keine der Abbildungen	mit der Zusammenfassung ver	öffentlicht.				

Betr. Anspruch Nr.

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES . I PK 7 C23C14/06 C23C14/35

B05D7/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröllentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Kategorie* Bezeichnung der Verötfentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Malegone	oversaming an verocensoring, some confidence one regade de si desacta commenden reae	Dett. Anapadon Ht.
А	BURROWS P E ET AL: "Ultra barrier flexible substrates for flat panel displays" DISPLAYS ELSEVIER UK, Bd. 22, Nr. 2, Mai 2001 (2001-05), Seiten 65-69, XP002342349 ISSN: 0141-9382 Seite 67, Absatz 2 - Seite 68, Absatz 2	1-27
Α	AFFINITO J D: "HYBRIDIZATION OF THE POLYMER MULTI-LAYER (PML) DEPOSITION PROCESS" SURFACE AND COATINGS TECHNOLOGY, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, Bd. 133/134, November 2000 (2000-11), Seiten 528-534, XP001058306 ISSN: 0257-8972 das ganze Dokument	1-27
	-/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

X Siehe Anhang Patentfamilie

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die goekgnet ist, einen Prioritälsanspruch zweifelhalt er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- ausgeticht)
 *O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung.
- eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen beziehl "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- T* Spätere Veröftentlichung, die nach dem internationalen Anmoldedatum oder dem Prioritätsdatum veröftentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollisitert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeltegenden Prinzips oder der ihr zugrundeltegender Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Effindur kann nicht als auf erfinderischer Tällgkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorien Veröffentlichung gebracht wird und diese Netfleichung für einen Fachmann nahellegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
- Absendedaturn des Internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche August 2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016

07/09/2005

Bevollmächtigter Bediensteter

Patterson, A

PCT/EP2004/013258

		P2004/013258
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
alegorie*	Bezeichnung der Veröttentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Beir. Anspruch Nr.
	EP 0 815 283 B (EMPA EIDGENOESSISCHE MATERIALPRUEFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT; EIDGENO) 19. Juni 2002 (2002-06-19) in der Anmeldung erwähnt Ansprüche 1-9	1-27
9		

Ang	aben zu Veröffentlichung	en, die 2	tur selben Patentfamilie go	ahören		PCT/EP20	Altonzeichen 004/013258
	echerchenbericht ries Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) de Patentfamilie	r	Datum der Veröffentlichung
EP	0815283	В	07-01-1998	AT AU DE EP WO	21952 493619 5960937 081528 962858	6 A 0 D1 3 A1	15-07-2002 02-10-1996 25-07-2002 07-01-1998 19-09-1996
					mar and Add Startesh Accounted and an end		

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE			PCT		
DIE D	HOFER-PATENTSTE DEUTSCHE FORSCHU odstrasse 68 36 München NY	EINGEGANGEN 12. Sep. 2005	INTERNATION UND DES SC INTERNATION	IALEN REG HRIFTLICH IALEN REG ER DER ER	ÜBERMITTLUNG DES CHERCHENBERICHTS HEN BESCHEIDS DER CHERCHENBEHÖRDE RKLÄRUNG
		Erl	Absendedatum	(
			(Tag/Monal/Jahr)	07/09	/2005
Aktenze	ichen des Anmelders ode	r Anwalts			
03F43	485-FEP		WEITERES VORGE	HEN	siehe Punkte 1 und 4 unten
	onales Aktenzeichen P2004/013258		Internationales Anmeio (Tag/Monat/Jahr)	dedatum 23/11	/2004
Anmelde			1		,
FRAUN	HOFER-GESELLSCA	HFT ZUR FÖRDERUNG DE	R		
_					
1. X		etellt, daß der internationale Recht tellt wurden und ihm hiermit übermi		arlftliche Bes	scheld der Internationalen
		rungen und einer Erklärung naci			
	Der Anmelder kann auf e	eigenen Wunsch die Ansprüche de	r internationalen Anmelde	ung ändem 4	(siehe Regel 46):
	Bis wann sind Anderur				
	Die Frist zur Elnreichung internationalen Recherch	solcher Änderungen beträgt üblich	nerweise zwel Monate ab	der Übermi	ttlung des
	Wo sind Anderungen e				
	Unmittelbar beim Interna	itionalen Büro der WIPO, 34, chem den Anmerkungen auf dem Beiblatt		-1211 Genf	20,Telefaxor.: (41-22) 740.14.3
2. 🔲	Dem Anmelder wird mitg	eteilt, daß kein Internationaler Rec	herchenbericht erstellt wi	ird und daß	hm hiermit die Erklärung nach
3. 🔲	Artikel 17 (2) a) sowie der schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde übermittelt werden. Hinstichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 w				
	dem Anmelder mitgeteilt der Widerspruch un Widerspruchs als a sind.	, daß nd die Entscheidung hierüber zusar auch der Entscheidung hierüber an	mmen mit seinem Antrag die Bestimmungsämter d	, auf Übermi dem Internat	ttlung des Wortlauts sowohl des ionalen Büro übermittelt worden
		eidung über den Widerspruch vorlie	egt; der Anmelder wird be	enachrichtigt	, sobald eine Entscheidung
noch koine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung derröften wurde. 4. Zur Erinnerung: Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90%; 1s. von 30% von Abschuttig der technischen Vorbereitungen int die einenstande Veröffentlichung eine Erklätung über de Zurücknahme der internationalen Büro ein infernationalen vorläuftiger Prüfungsbericht erstellt worden ist bzw. geräde erstellt wird. Eine soche Seitungnahme wird auch der Öffentlichkeit zugänglich gemanch, allerdings erst nach Ablauf von 30 knoralen seit dem Prioritätisdatum in bezug auf einige Bestimmungsämter ist innerhalb von 18 Monaten seit dem Prioritätisdatum ein der 4 mehret vorläuftiger vorläuftiger vorläuftiger vorläuftiger verschlichten ein erstellt worden ist bzw. geräde erstellt wird. Eine soche Seitungnahme vorläuftiger Präser vor desen Bestimmungsämter vorgeschriebenen Handlungen vorläuftiger in Konaten vorläuftiger vorläuftiger ein kannet vorläuftiger vorläuftiger ein Konaten vorläuftiger vorläuftiger vorläuftiger ein Konaten vorläuftiger vorläuftiger vorläuftiger ein kannet vorläuftiger vorläuftiger vorläuftiger ein vorläuftiger ein kannet vorläuftiger vorläuftiger vorläuftiger ein kannet vorläuftiger vorläuftiger vorläuf					
	ad Dantes askidt des later	antinentes Destroyabanhot inde	Develop Set Vietes Develo		

Earth of DCT/ICA/220 / Innuar 2004)

| Curopäisches Patentamt, P.B. S818 Patentiaan 2 | NL_-2280 HV Rijswijk | Tel. (+31-70) 340-2040 | Pax: (+31-70) 340-3016

(Cinho Anmorlumnon and Ballylatt)

Trudy Thoen-de Jong

Diese Ammerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikei 19 geben. Diesen Ammerkungen liegen die Effordsomisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiel des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordung und der Verwattungsrichteine zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen swischen diesen Ammerkungen und obengenannten Texten sind letzters maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Laiftaden für Ammelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu eränderhimen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhall des internationalen Recherchophosichts hat der Annosider die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu handen. Es ist jedocht zu betonen, diet, die alle Teils der internationalen Annosiderag (Neuroben, Bernationalen und Zeichungen) während des internationalen vordufligen Pfülungsvorfahrens gehindert werden können, nomateweise keine Nebhendigkeit bestalt, Andersungen der Ansprüche nach Artikkei 19 sinzurreichen, "Büler wenn der Anmelser 2.5. zum Zwecke diese vordaligigen Schutzes die Verdfentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Anderung der Ansprüche vor ihrer internationalen vordamitigen vorder, Westernation zu dem Verdfentlichung vorlegt, Westerhein ist zu bezeichen daß ein vordafürger Schutz zur eineigen Statze en Affallich

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Anderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monden ab der Übermittung des internationalen Recherchescheichte oder innerhalb von sechzahn Monatien ab dem Prioritätefatium, jein nechden, weiche Friet spätze sällatt. Die Andermangen gelten jedoch als rechtzeilig eingereicht, wenn sie internationalen Sürn nach Abbaut der maßgebon den Frist, aber noch ver Abschliß der frechnischen Vorbereichungen für dies informationale verfetzlichtung (Regied \$51) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Recel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

in weicher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fæssung.

Für jedes Anapruchsblatt, das eich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, eind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüchen intet neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung eind die Ansprüche fortfaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19(1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen Internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen Internationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So all insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlaufende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengelaßt werden), ober

- der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begieltschreiben zu erläutem sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 "Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch gesinderte Ansprüche gleicher Numerierung erselzt; Ansprüche 30, 33 und 36 urwerändert, neue Ansprüche 95 bis 5 hingugefügt."
- (Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren): "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- Néma rusprůnglich 14 Ampspüche axisiterian und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ampspüche gestrichen werden und neur Anspüche i bis 6 und 14 unvertender; Ampspüche 1 bis 6 und 14 unvertendert, Ampspüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ampspüche 15, 16 und 17 hiszugelütg. "Oder Anspüche und 13 gestrichen; neue Ampspüche 15, 16 und 17 hiszugelütg." Oder Anspüche und 13 gestrichen; neue Ampspüche 15, 16 und 17 hiszugelütg. tale übrigen Ampspüche unswählich.
- [Wenn verschiedene Arten von Anderungen durchgeführt werden]: Ansprüche 1-10 urwerändert, Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 15 ernetzt, Ansprüch 17 in geänderde Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt.

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den gelandetren Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteren nicht. Sie ist auf einem gesondarten Blatt einzureichen und in der Übeschrift als seiche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten Erkfärung nach Artikkel 19 (1)*.

Die Erkfarung dart keine herabestzenden Außerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedatung von in dem Beriert angelähren Veröffentlichungen enthalten is, die dar auf im infamationalen Recherchenbericht augeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationalevorläufige Prüfung

lat zum Zeitpunkt der Einreichung von Anderungen nach Arfäel 19 bereits ein Antrag auf internstionale vorfalligige Pfütung gestellt worden, so sollte der Annender in seinem Interesses gelichtzung mit der Einreichung der Anderungen beim Intermation alen Büra auch eine Kopie der Anderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siebe Regei 62.2 a), etate Satz).

Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingeriebthen Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmter/ausgewählten Anter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordernisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu anfrehmen.

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENANDETT AUF DEM , GEBIET DES PATENTWESENS

Abser	der: INTERNAT	TONALE RECH	ERCHENBEHÖRDE			
An:			The sale of the sa	PCT		
	siehe Fori	mular PCT/ISA	Z20	SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE		
				(R	egel 43bis.1 PCT)	
				Absendedatum (Tag:Monat/Jahr) sie	he Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)	
	nzeichen des Anmel e Formular PCT			WEITERES VORO	GEHEN	
	nationales Aktenzeio /EP2004/013258		Internationales Anmelded	atum (TagMonat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 02.02.2004	
	nationale Patentklas C14/06, C23C14		er nationale Klassifikation ur L	nd IPK		
Anm FRA		SELLSCAHFT	ZUR FÖRDERUNG D	ER		
1.	Dieser Besche	id enthält Anga	aben zu folgenden Pun	ikten:		
	Feld Nr. I	Grundlage des	Bescheids			
	Feld Nr. II	Priorität				
	Feld Nr. III	Anwendbarkei	t ⁻		ne Tätigkeit und gewerbliche	
	☐ Feld Nr. IV		nheitlichkeit der Erfindung			
	Feld Nr. V	•			n der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit	
		und der gewer	blichen Anwendbarkeit; l	Interlagen und Erklär	ungen zur Stützung dieser Feststellung	
	Feld Nr. VI		geführte Unterlagen			
	Feld Nr. VII		ngel der internationalen /			
	☐ Feld Nr. VIII	Bestimmte Bei	merkungen zur internatio	nalen Anmeldung		
2.	WEITERES VOI	RGEHEN				
	Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66. bis b) mitgeteit hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.					
	Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsgatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen.					
	Weitere Optione	n siehe Formbla	att PCT//SA/220.			
3.						
Nam	e und Postanschrift	der mit der interna	ationalen	Bevollmächtigter Bedi	ensteter	
Reci	nerchenbehörde				11	

)

Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016

Patterson, A Tel. +31 70 340-3421



bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.

4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids

1.	ers	tellt	worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
		e	r Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache rstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der ernationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regein 12.3 und 23.1 b)).
2.	wur	sich rde i rden	tlich der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt :
	a. /	Art d	les Materials
	-		Sequenzprotokoll
	-		Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
	b. F	orn	n des Materials
	1		in schriftlicher Form
	1		in computerlesbarer Form
	c. 2	Zeitp	ounkt der Einreichung
			in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
			zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
			bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.		eir	urden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls undoder einer dazugehörigen Tabelle igereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten er zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis.*1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche 1-27

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche 1-27

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja: Ansprüche: 1-27

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

- 1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: BURROWS P E ET AL: "Ultra barrier flexible substrates for flat panel displays"

 DISPLAYS ELSEVIER UK, Bd. 22, Nr. 2, Mai 2001 (2001-05),

 Seiten 65-69, XP002342349 ISSN: 0141-9382
 - D2: EP 0 815 283 B (EMPA EIDGENOESSISCHE MATERIALPRUEFUNGS- UND FORSCHUNGSANSTALT: EIDGENO) 19. Juni 2002 (2002-06-19)
- 2 Das Dokument D1, wird als n\u00e4chstliegender Stand der Technik angesehen. Es offenbart (siehe Kapitel 3 "Barix™ multi-layer coatings") ein Verfahren zur Herstellung eines Ultrabarriere-Schichtsystems durch Vakuumbeschichtung eines Substrats, wobei ein Wechselschichtsystem aus Gl\u00e4ttungsschichten und gesputterten, transparenten, keramischen (Al₂O₃) Schichten gebildet wird, und mindestens eine Gl\u00e4ttungsschicht sich zwischen zwei keramischen Schichten befindet. Die Gl\u00e4ttungsschichten werden erzeugt durch Vakuumaufdampfen von Acryl-Monomeren und anschließende Aush\u00e4rtung zu Polymer-Schichten. Der Gegenstand des unabh\u00e4ngigen Anspruchs 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, dass w\u00e4hrend der Abscheidung der Gl\u00e4ttungsschicht ein Monomer in eine evakuierte Beschichtungskammer eingelassen wird, in der ein Magnetronplasma betrieben wird.
- 2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33 (2) PCT). Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein Verfahren zur Herstellung eines transparenten Barriereschichtsystems anzugeben, wobei das Verfahren sowohl von der Beschichtungsgeschwindigkeit als auch von den Vakuumanforderungen mit dem Magnetronsputtern kompatibel ist.
- 2.2 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT), da die Polymerisation von Monomeren zu Glättungsschichten mittels eines Magnetronplasmas nicht durch den Stand der Technik nahgelegt wird. Obwohl D2 (siehe Ansprüche 1-9) ein Verfahren offenbart, wobei Magnetronzerstäubung und

eine Plasmapolymerisation gleichzeitig stattfinden, gehen die zwei Verfahrensschritte gemäß dem Anspruch 1 nicht aus diesem Dokument hervor.

2.3 Die Ansprüche 2-27 sind abhängig vom Anspruch 1 und erfüllen deshalb ebenfalls die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen T\u00e4tigkeit.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FÜR DIE

DEUTSCHE FORSCHUNG Leonrodstrasse 68 80636 München Germany

2 fi (an 2005

Date of mailing (day/month/year) 10-January 2005 (10.01.2005)		IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference	,	International application No.
03F43485-FEP		PCT/EP2004/013258

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V. (for all designated States except US)

CHARTON, Christoph et al (for US)

23 November 2004 (23.11.2004) International filing date 02 February 2004 (02.02.2004) Priority date(s) claimed

Date of receipt of the record copy 14 December 2004 (14.12.2004) by the International Bureau

List of designated Offices

AP :BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW

EA :AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LU,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National : AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM, DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,

LT_LU_LV_MA_MD_MG_MK_MN_MV_MX_MZ_NA_NI_NO_NZ_OM_PG_PH_PL_PT_RO_RU_SC_SD_SE_SG_SK_ SL,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN.YU.ZA.ZM.ZW

The International Bureau of WIPO 34. chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

Thomas ROCHAIX (Fax 338 8970)

Facsimile No. (41-22) 338.89.70

Telephone No. (41-22) 338 8897

PC 1/EF2004/013230

Continuation of Form PCT/IB/301

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

Date of mailing (day/month/year) 10 January 2005 (10.01.2005)	IMPORTANT NOTIFICATION	
Applicant's or agent's file reference 03F43485-FEP	International application No. PCT/EP2004/013258	

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X time limits for entry into the national phase - see updated important information (as of April 2002)

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority,

requirements regarding priority documents (if applicable)





INFORMATION ON TIME LIMITS FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the "national phase" must be entered before each of the designated Offices indicated on the cover sheet of this Notification by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by Articles 22 and 39 and the applicable national laws. In addition, the applicant may also have to comply with other special requirements applicable in certain Offices. It is the applicant's responsibility to ensure the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most Offices do not issue reminders to a poolicants in connection with the entry into the national phase.

The applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be and MONTHS from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(11), but also in respect of any designated Office, in the absence of filling of such demand, where Article22(11) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see PCT Gazette No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 1992.6, 19932 and 1934/3, as well as the PCT Newsletto. October and November 2001 and Petrous 2002 (1 see 2001).

In practice, time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain designated or elected Offices. For regular updates on the applicable time limits, 20,21, 30 or 31 months, or other time limit), 00 fice, prefer to the PCT Gazettel "Section IV" part published on a weekly basis), to the PCT Newsletter (on a monthly basis) and to the relevant National Chapters in Volume II of the PCT Applicant's Guide (the paper version of which is updated usually wrise a year and the Internet version of which is updated usually not a weekly basis. Finally, a cumulative table of all applicable time limits for entering the national phase is available from IMPO's Internet site, via links from various passes the site including those of the Sazette, Newsletter and Guide, at Intp://www.wipo.intpde/en/index.html.

Information about the requirements for filing a demand for international preliminary examination is set out in the PCT Applicant's Guide, Volume NA, Chapter IX. Note that only an applicant who is a national or resident or a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter III.

REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is dalimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, contribed by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Ordice (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 18 most her priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before that stee or international publication of the international supplication, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Neb 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rell of 17.10h).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau or if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit inclinated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within the time limit which is reasonable under the circumstances (Rule 17.1(g)).

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit (and all other PCT time limits) is the filing date of the earliest application whose priority is claimed (Article 2(xi)(b)).

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FÜR DIE DEUTSCHE FORSCHUNG Leontodstrasse 68 80636 München ALLEMAGNE

2 3. März 2005 Erl.

Date of mailing (day/month/year)
09 March 2005 (09.03.2005)

Applicant's or agent's file reference

IMPO

IMPORTANT NOTIFICATION

03F43485-FEP
International application No.
PCT/EP04/013258

International filing date (day/month/year)
23 November 2004 (23.11.2004)

International publication date (day/month/year)

Priority date (day/month/year) 02 February 2004 (02.02.2004)

Applicant

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V. et al

- 1. By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority documently relating to all cardiar application(s) whose prompty is claimed. Unless otherwise indicated by the letters NRs, "in the figh-hand column or yet an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.4(a) or (b).
- 2. Of applicable) The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which, an the date of making of this Ezran, had not yet been received by the International Bureau under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a) which priority document must be submitted by the applicant faint to such that protriet of the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the protrity document within the applicant be time finit under that Rule, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(a) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 3. If applicable/An asterisk (?) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b) (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the Rule 17.1(c) provides that no designated Office in may disregard the priority document concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the ericonstitution.

 Priority_date
 Priority_application_No.
 Country_or_regional_Office or_FECT_receiving_Office
 Date_of_receipt of_priority_document

 02 February 2004 (02.02.2004)
 10 2004 005 313.8
 DE
 07 February 2005 (07.02.2005)

The International Bureau of WIPO	Authorized officer
34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Guillemot Marie-Christine
	Facsimile No. +41 22 338 89 70
Paesimile No. +41 22 740 14 35	Telephone No. +41 22 338 9838

PCT

SECOND AND SUPPLEMENTARY NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

Date of mailing (day/month/year) 08 June 2006 (08.06.2006) To:

ALLEMAGNE.

FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FÜR DIE DEUTSCHE FORSCHUNG EINGEGANGEN Leonrodstrasse 68

80636 München 19 Juni 2006

Erl.

IMPORTANT NOTICE

Applicant's or agent's file reference 03F43485-FEP International application No. PCT/EP2004/013258

International filing date (day/month/year) 23 November 2004 (23.11.2004) Priority date (day/month/year) 02 February 2004 (02.02.2004)

Applicant

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V. et al

- 1. ATTENTION: For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), does not apply, please see Form PCT/IB/308(First Notice) issued previously.
- 2. Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, does apply, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below: 11 August 2005 (11.08.2005)

AU, AZ, BY, CN, CO, DZ, EP, HU, KG, KP, KR, MD, MK, MZ, NA, PG, RU, SY, TM, US

In accordance with Rule 47.1(e-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

3. The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, does apply, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, BA, BB, BG, BR, BW, BZ, CA, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EA, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LV, MA, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PH, PL. PT. RO. SC, SD, SG, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, UA, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZW

In accordance with Rule 47.1(e-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated or elected Office(s) listed above, the applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 30 MONTHS from the priority date.

in practice, time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated or elected Office(s) listed above. For regular updates on the applicable time limits (30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the PCT Gazette, the PCT Newsletter and the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at http://www.wipo.int/pct/en/index.html.

It is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34. chemin des Colombettes 1211 Geneva 20. Switzerland

Authorized officer

Agnes Wittmann-Regis

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 89 70

PCT

FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

Date of mailing (day/month/year) 09 September 2005 (09.09.2005)

Applicant's or agent's file reference 03F43485-FFP To:

FRAUNHOFER-PATENTSTELLE FÜR DIE DEUTSCHE FORSCHUNG

Leonrodstrasse 68 80636 München ALLEMAGNE



IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/EP2004/013258

International filing date (day/month/year) 23 November 2004 (23.11.2004) Priority date (day/month/year) 02 February 2004 (02.02.2004)

Applicant

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V. et al

- ATTENTION: For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), does apply, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration of 28 months from the priority date).
- Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1. April 2002, does not apply, hardware equested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93/zic.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
 11 Austral 2005 (11.08.2005)

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be fermithed by the amplicant to the desicated Offices).

The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, does not apply, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 3bit.1:

LU. SE. TZ. UG. ZM

In accordance with Rule 47.1(e-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for international preliminary examination has been filed before the expiration of D months from the priority date (see Article 39(1)), the applicable time limit for entering the national phase will, subject to what is said in the following paragraph, be 20 MOVINTB from the priority date.

In practice, time limits other than the 20-month time limit will enotine to apply, for various periods of time, in respect normal decisions of Offices isted above. For regular updates on the applicable time limits (20 or 21 months, or other time limit, colffice by Office, effect to the PCT Gazene, the PCT Newsletter and the PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet Site, at http://www.wios.inforce/erinduck.html.

It is the applicant's sole responsibility to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Agnes Wittmann-Regis

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 89 70